

OTFC-1550 规格例

	
设备名称	OTFC-1550C/D
真空室	SUS304, $\phi 1550 \times 1800\text{mm(H)}$
工件架	$\phi 1400\text{mm}$
工件架转速	5rpm to 50rpm(可变)
光学膜厚控制	Hom2-R-VIS350A 型光学控制 波长范围: 350nm to 1100nm 反射式/透射式
水晶式膜厚计	XTC/2+6 点式水晶传感器
蒸发源	电子枪 2 套
离子源	17cmRF 离子源
排气系统	机械泵+2 个扩散泵+Polycold (或 2 个冷凝泵)
性能	
达到压力	$9.0 \times 10^{-5}\text{Pa}$ 以下
排气时间	30 分 (大气压 $\sim 1.3 \times 10^{-3}\text{Pa}$)
基板温度	最高: 350°C
工作条件	
设备尺寸	约 $6000\text{mm(W)} \times 7500\text{mm(D)} \times 3800\text{mm(H)}$
电源	3 相, 200v, 50/60Hz, 约 115KVA
水流量	150 升/分以上
空气压力	0.5MPa 以上
重量	约 10000kg